

Anmeldung für eine Tagungsteilnahme

Bitte bis zum 18.11.2009 faxen an
(030) 63 92 – 65 01



Name _____

Vorname _____ Titel _____

Firma/Einrichtung _____

Adresse _____

Telefon _____ Fax _____

E-Mail _____

Spätmeldung Poster ja nein

Titel des Posters (eine Kurzfassung des Beitrages mit Angabe der Co-Autoren und der zugehörigen Firmen / Einrichtungen bitte beifügen)

Teilnahmegebühren

160,00 €, Studenten 20,00 €

Überweisung an:

IAP e.V. · Konto-Nr. 553 24 86 00 · Deutsche Bank AG Berlin · BLZ 100 700 00

Anmeldung von Ausstellungsfläche

4 m² 6 m² 8 m²

Miete 85,00 €/m²

Ein Vertreter des Ausstellers nimmt gebührenfrei an der Tagung teil.

Hotelreservierung

zu Vorzugspreisen von 63,00 € für ein EZ plus 12,00 € Frühstück

EZ DZ vom _____ bis _____

Ort, Datum

Unterschrift

Veranstalter

VDI/VDE – Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA);
VDI-Bezirksgruppe Adlershof;
Optec Berlin-Brandenburg e.V.;
IAP Institut für angewandte Photonik e.V.;
IfG – Institute for Scientific Instruments GmbH
FhG-IZM (Fraunhofer Institut Zuverlässigkeit und Mikrointegration), Berlin;
TSB – Technologiestiftung, Berlin
Geschäftsstelle Adlershof;
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin;
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig und Berlin
Technische Universität Berlin
WISTA-MANAGEMENT GMBH

Organisation und Korrespondenzanschrift

Dipl.-Ök. A. Weiß (Organisation)
Tel.: (030) 63 92 – 65 09
Fr. D. Zimani (Sekretariat IAP e.V. und IfG GmbH)
Tel.: (030) 63 92 – 65 00
IAP Institut für angewandte Photonik e.V.
Rudower Chaussee 29/31
12489 Berlin
Fax: (030) 63 92 – 65 01
E-Mail: info@ifg-adlershof.de

Programmkomitee

E. Auerswald, IZM, Berlin
B. Beckhoff, PTB, Berlin
A. Bjeoumikhov, IfG GmbH, Berlin
F. Burgäzy, Bruker AXS GmbH, Karlsruhe
W. Daum, BAM, Berlin
J. Flock, ThyssenKrupp Stahl AG, Duisburg
M. Haschke, Bruker AXS Microanalysis GmbH, Berlin
A. Janßen, FH Münster
B. Kanngießer, TU Berlin
M. Krumrey, PTB, Berlin
N. Langhoff, IfG GmbH, Berlin
A. Kharchenko, PANalytical, Almelo, Niederlande
M. Maiwald, BAM, Berlin
H. Miersch, Spectro GmbH & Co. KG, Kleve
U. Panne, BAM und Humboldt-Universität, Berlin
P. U. Pennartz, Rigaku Innovative Technologies
W. Sandner, Max-Born-Institut Berlin
Th. Schülein, Bruker AXS Microanalysis GmbH, Berlin
R. Wedell, IAP, Berlin
J. Wiesmann, Incoatec GmbH, Geesthacht

Anfahrtsskizzen auch unter www.adlershof.de



PRORA 2009

Fachtagung Prozessnahe Röntgenanalytik

Programm

26. und 27. November 2009

im WISTA – Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof
Einstein-/Newton-Kabinett
Bunsensaal
Rudower Chaussee 17
12489 Berlin



PROGRAMM

DONNERSTAG, 26. 11. 09

- 10.00–10.30 Eröffnung
H. Schmitz (WISTA-MANAGEMENT GmbH)
G. Tränkle (OptecBB) (10 min)
Einführungsbeitrag
N. Langhoff (IfG GmbH)
100 Jahre Innovation aus Adlershof,
50 Jahre analytischer Gerätebau (20 min)
- 10.30–12.20 **Prozessanalytik in der Photovoltaik**
Leitung: *R. Wedell*
- 10.30–11.00 *A. Neisser (Sulfurcell Solartechnik)* (E)
Anforderungen an die Analytik für die Prozesskontrolle bei der Herstellung von Dünnschichtsolarzellen aus industrieller Sicht
- 11.00–11.20 *V. Rößiger (Helmut Fischer GmbH Sindelfingen)*
Inline-Messung von CIGS-Schichten mit RFA
- 11.20–11.40 *A. Bjeoumikhov u.a. (IfG GmbH)*
Rapid-XRF-Messverfahren für die Prozesskontrolle bei der Herstellung von Dünnschichtsolarzellen
- 11.40–12.00 *J. Piltz (amtec GmbH)*
Erfahrungen bei Einsatz von RFA-Geräten zur Prozesskontrolle in Beschichtungsanlagen
- 12.00–12.20 *C. Streack, B. Beckhoff, F. Reinhardt, M. Kolbe, B. Kanngießer, C. A. Kaufmann, H. W. Schock (HZB, TU Berlin und PTB)*
Referenzprobenfreie Röntgenfluoreszenzanalyse unter streifendem Einfall zur Tiefenprofilierung von Cu(In,Ga)Se₂-Dünnschichten
- 12.20–13.30 Mittagspause
- 13.30–15.00 Leitung: *V. Rößiger*
- 13.30–14.00 *R. Hunger (Solibro GmbH)* (E)
XRF-basierte Prozessregelung in der industriellen Dünnschichtsolarzellen-Fertigung:
Die CIGS-Abscheidung der Q-Cells Module
- 14.00–14.20 *T. Salge, E. Blokhina, M. Haschke (Bruker AXS Microanalysis GmbH)*
Analysis of thin film solar cells with XRF and SEM-EDS
- 14.20–14.40 *I. Kötschau, O. Pursche, J. Sandherr, T. Hahn, A. Kampmann, D. Schmid (centrotherm photovoltaics AG)*
In-situ growth studies of Cu(In,Ga)Se₂ thin films by angle dispersive X-ray diffraction
- 14.40–15.00 *M. Pagels, F. Reinhardt, B. Pollakowski, M. Roczen, K. Lips, C. Becker, B. Rech, B. Kanngießer, B. Beckhoff (TU Berlin, PTB und HZB)*
GIXRF-NEXAFS Untersuchungen an Silizium-Dünnschichtsolarzellen: Ein erster Einblick in die Chemie von Si/ZnO Grenzschichten
- 15.00–15.30 Kaffeepause

- 15.30–17.35 **Neue Entwicklungen bei Komponenten für röntgenanalytische Geräte**
Leitung: *Th. Schüle*
- 15.30–15.55 *A. Erko (HZB für Materialien und Energie/BESSY)* (E)
Moderne Röntgenoptiken für analytische Anwendungen an Synchrotronbeamlines und im Labor
- 15.55–16.15 *M. Procop u.a. (IfG GmbH)*
Fortschritte bei Herstellung und Anwendung moderner Kapillaroptiken
- 16.15–16.35 *P. Hoghoj, P. Panine, S. Rodrigues (Xenocs SA, Sassenage, France)*
Effiziente Quelle-Optik-Kombinationen für die Röntgenanalytik
- 16.35–16.55 *R. Terborg (Bruker AXS Microanalysis GmbH)*
Advances in the development of an annular four-channel Silicon Drift Detector
- 16.55–17.15 *G. Blaj (PANALYTICAL BV Almelo, The Netherlands)*
Medipix, a new generation of x-ray detectors for material analysis
- 17.15–17.35 *P. Laggner (Hecus X-Ray Systems GmbH, Graz, Österreich)*
Novel opportunities for SAXS in industrial process analytical technology
- 18.00–19.30 **Postersession und Rundgang durch die Firmenausstellung**
Eröffnung: *A. Janßen*
- 19.30 Gemeinsames Abendessen
Abendvortrag
Dr. Peter Strunk (WISTA-MANAGEMENT GmbH)
100 Jahre Innovation aus Adlershof oder wie aus Umbrüchen Aufbrüche wurden.

FREITAG, 27. 11. 09

- 9.00–10.30 **Applikationen in der Industrie**
Leitung: *B. Kanngießer*
- 9.00–9.30 *A. Vigilante (Bruker-AXS GmbH)* (E)
X-ray diffraction, X-ray reflectometry and micro-XRF for process control in semiconductor fabs
- 09.30–09.50 *R. Dietsch, Th. Holz, H. Borrmann, St. Griessl (AXO Dresden GmbH, MPI for Chemical Physics of Solids und HUBER Diffraktionstechnik GmbH & Co KG)*
Multilayer optics for energies above 8keV-Application of GaK α , GaK α , AgK α , MoK α in reflection and transmission geometry
- 9.50–10.10 *G. Wacker, St. Hanning, A. Janßen, Chr. Mans, M. Kreyenschmidt (alle FH Münster), M. Ostermann (BAM)*
Anwendung der RFA zur Bestimmung prozess-relevanter Elemente in Sekundärbrennstoffen

- 10.10–10.30 *R. Singer, W. Klöck, C. Fülber, M. Eckhardt*
Roanalytic GmbH, Taunusstein
Extending the Spatial Resolution Limits of μ -XRF
- 10.30–11.00 Kaffeepause
- 11.00–12.25 Leitung: *N. Langhoff*
- 11.00–11.25 *A. Haase, A. Schafmeister, R. Stabenow (SEIFERT Analytical X-ray / GE Sensing & Inspection GmbH Ahrensburg)* (E)
Industrielle in-line-Orientierung von Si-Ingots mit XRD
- 11.25–11.45 *D. Docenko, A. Sokolov (Bruker Baltic, Latvia), A. Pechersky (AP Systems)*
On-line XRF measurements of ore composition and coating thickness
- 11.45–12.05 *V. Nikolaev, A. S. Bakhvalov, E. V. Chizhova (Scientific Instruments, St. Petersburg, Russia)*
Application of new μ XRF spectrometer RAM-30 μ
- 12.05–12.25 *J. D. Ferrara, A. Kishi, Y. Namatame, P. Pennartz, A. Sasaki (Rigaku, USA, Japan and Europe)*
Use of Simultaneous XRD and DSC to Study Phase Changes in Materials
- 12.25–13.30 Mittagspause
- 13.30–15.55 **Neue röntgenanalytische Methoden**
(Forschungsvorlauf)
Leitung: *B. Beckhoff*
- 13.30–13.55 *P. Siffalovic (Slovak Academy of Science, Bratislava)* (E)
The novel applications of table-top GISAXS systems
- 13.55–14.15 *St. Becker (phoenix x-ray / GE Sensing & Inspection GmbH Wunstorf)*
Hochauflösende Röntgen-Computertomographie für materialwissenschaftliche Analysen: Vergleich zwischen Röhren- und Synchrotron-basierter CT
- 14.15–14.35 *I. Tiseanu, T. Craciunescu, C. Dobra, A. Sima (National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics, Bucharest, Romania)*
Tomo-Analytic – a combined fully 3D X-Ray microtomography and microbeam fluorescence system
- 14.35–14.55 *M. Müller, B. Beckhoff, M. Kolbe (PTB Berlin)*
Referenzprobenfreie Quantifizierung in der Röntgenfluoreszenzanalyse unter streifendem Einfall
- 14.55–15.15 *A. Zierau, D. Lerche, R. Wedell (LUM GmbH und IAP e.V.)*
Charakterisierung von Entmischungsphänomenen hochkonzentrierter Dispersionen mit Hilfe von Röntgentransmission
- 15.15–15.40 *B. Kanngießer (TU Berlin)* (E)
BliX – ein industrieorientiertes, innovatives Applikationslabor zum Transfer von Röntgentechnologien höchster räumlicher und zeitlicher Auflösung
- 15.40–15.55 Schlusswort